

ArF レジストの生産・研究体制拡充について

住友化学は、このたび、ArF（フッ化アルゴン）エキシマレーザー用レジスト（半導体製造用感光樹脂）について、大阪工場内に専用工場を新設するとともに、最新のArF液浸スキャナー（回路露光装置）を含む評価装置の拡充を行なうことといたしました。

昨今、半導体回路の微細化の進展は著しく、最先端プロセスにおいては、従来のArFドライ用レジストに替わりArF液浸用レジストの市場が立ち上がりつつあります。現在、半導体業界は、フラッシュメモリーをはじめとして回路線幅45nmプロセスへの移行期にあり、主要工程には、ArF液浸用レジストが主流となるまでに進化しています。また、ArF液浸用レジストは、線幅45nmにとどまらず、ダブルパターニング（2重露光）等の技術確立により、線幅32nm以降の微細プロセスにも使用されることが見込まれています。

住友化学は、ArF露光技術の初期段階から一貫してArFレジストの最先端グレード「スミレジスト PAR[®]」シリーズを市場で展開してきました。特にArF液浸用レジストについては、トップコートの有無に関わらず使用できる点が、市場から高く評価され、多くの半導体メーカーに採用されています。また、ArF液浸用レジストに対応した、より高機能な「光酸発生剤（PAG）」などの基幹材料の開発に成功したことから、それらを取り入れた製品の量産化も図るため、この度、大阪工場内にダウンフロー仕様のクリーン化技術を活用したArFレジスト専用工場を新設し、併せて、最新のArF液浸スキャナー等の評価装置を導入することとしたものです。

住友化学は、今回の製造、研究体制拡充により、アジア地域を中心とした半導体メーカーにArFレジストを迅速に開発、供給し、一層充実した需要家サービスを行ってまいります。当社は、これらによる、半導体分野事業の強化を通じて、重点事業である情報電子材料事業のさらなる拡大を進めていきます。

【設備投資概要】

1. 場 所： 大阪工場
2. 能 力： 約100,000ガロン/年
3. 内 容： ArFレジスト専用工場、ArF液浸スキャナー等評価装置
4. 完成時期： 2008年第3四半期 評価装置稼動開始
2008年第4四半期 専用工場完成

以 上